《模拟电子技术基础笔记》

死抠

版本: 2.10

更新: April 26, 2019



1 常用半导体器件

1.1 基本概念

定义 1.1 (本征半导体) 纯净的具有晶体结构的半导体称为本征半导体。

注 本征半导体具有掺杂、热激活特性,即人为地掺入特定的杂质元素或在光照的条件下, 其导电性会有明显的变化。

定义1.2(载流子)运载电荷的粒子称为载流子。

注 本征半导体的载流子为自由电子和空穴,半导体在热激发下产生自由电子和空穴称为本征激发,逆过程称为复合。由于本征激发与复合是互逆过程,因此一定温度下的载流子浓度是一定的,并且载流子浓度与热力学温度近似成指数关系。多数载流子简称多子,少数载流子简称少子。

定义 1.3 (N(P) 型半导体) 在纯净的硅晶体中掺入五 (三) 价元素 (如磷 (硼)), 使之取代晶格中硅原子的位置, 就形成了 N(P) 型半导体。

注 由于磷(硼)在掺入硅晶体后会产生自由电子(空穴),因此称其原子为施主(受主)原子。 N: 自由电子数(多子)=正离子数(掺杂)+空穴数(热激发)。

P: 空穴数 (多子)= 负离子数 (掺杂)+ 自由电子数 (热激发)。

定义 1.4(扩散运动, 偏移运动) 由于浓度差而产生的运动称为扩散运动。在电场力作用下,

载流子的运动称为漂移运动。

注 多子的扩散运动会使空间电荷区1变厚, 少子的漂移运动会使空间电荷区变薄。

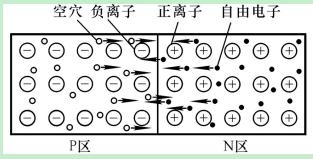


图 1: 扩散示意图

定义 1.5 (PN 结) 将 P 型半导体与 N 型半导体制作在同一块硅片上,其交界处会形成 PN 结。

注 由于多子的扩散运动,硅片的交界处会有大量的载流子复合,交界处的载流子浓度下降,称此区域为空间电荷区 (也称为耗尽区)。其电场性质主要受施主、受主原子影响,因此会产生内电场 (由 $N \to P$),阻碍多子的扩散运动 (P 区的空穴 $\to N$, N 区的自由电子 $\to P$),促进少子的漂移运动 (N 区的空穴 $\to P$, P 区的自由电子 $\to N$),从而最终达到稳态,形成 PN 结。

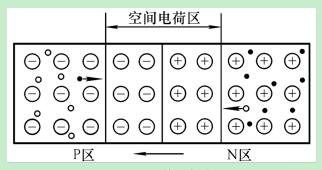


图 2: PN 结示意图

定义 1.6 (PN 结的正反接)将电源的正极接到 PN 结的 P端,负极接到 N端,则称此为正向接法 (正向偏置)。反向接法则与之相反。

性质 1.1 (PN 结的单向导电性) 下面讨论在没有击穿 2的情况下正反接的情况

- 在正向接法中, 由于空间电荷区等效的电源与外加电源方向相反
 - 若外加电压大于内部电压,将会使空间电荷区消失,即 PN 结导通。
 - 若外加电压小于内部电压,空间电荷区会变薄,仍不导电(近似)。
- 在反向接法中,由于空间电荷区等效的电源与外加电源方向同向,使空间电荷区变厚,内电场增强,形成漂移电流³。由于少子的数量极少,因此认为 PN 结反接时为

¹见定义1.5

²见性质1.3

³少子的偏移运动产生的电流

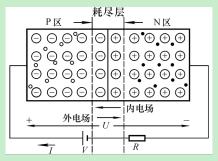


图 3: 正接示意图

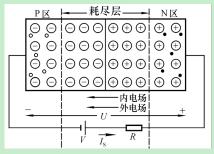


图 4: 反接示意图

截止状态且反向电流饱和。

定理 1.2 (PN 结的电流方程) 由理论分析可知, PN 结所加端电压 u 与流过它的电流 i 的关系为

$$i = I_S \left(e^{\frac{qu}{kT}} - 1 \right)$$

式中 I_S 为反向饱和电流,q 为电子的电量,k 为玻尔兹曼常量,T 为热力学温度。作换元 $U_T = \frac{kT}{a}$ 得

$$i = I_S \left(e^{\frac{u}{U_{\rm T}}} - 1 \right)$$

常温下 (T=300K), $U_T \approx 26\text{mV}$

性质 1.3 (击穿电压) 当外加电压过大时, PN 结会被击穿, 其中击穿叉分可逆击穿与不可逆击穿。

- 可逆击穿 (电流加以限制的情况下), 称产生可逆击穿时的电压为击穿电压 UBR
 - ▲ 齐纳击穿4
 - 雪崩击穿5
- 不可逆击穿——热击穿:不论是正接还是反接,当 PN 结消耗功率 (UI) 过大时,会 产生大量的热量,致使元件烧坏。

定义 1.7 (PN 结等效的电容) 具体内容跳转到第四章

4在高掺杂的情况下,因耗尽层宽度很窄,不大的反向电压就可在耗尽层形成很强的电场,而直接破坏共价键, 使价电子脱离共价键束缚,产生电子-空穴对,致使电流急剧增大。

5在掺杂浓度较低,耗尽层宽度较宽的情况下,当反向电压增加到较大数值时,耗尽层的电场使少子加快漂移速度,从而与共价键中的价电子相碰撞,把价电子撞出共价键,产生电子-空穴对。新产生的电子与空穴被电场加速后又撞出其它价电子,载流子雪崩式地倍增,致使电流急剧增加。

定义 1.8 (半导体二极管) 将 PN 结用外壳封装起来,并加上电极引线就构成了半导体二极管,简称二极管。

案例1 二极管几种常见的结构

- 点接触型二极管 (图 (a)), 适用于高频电路和小功率整流。
- 面接触型二极管 (图 (b)). 适用于工频 6大电流整流电路。
- 平面型二极管 (图 (c)), 结面积较大的可用于大功率整流, 结面积小的可作为脉冲数字电路中的开关管。

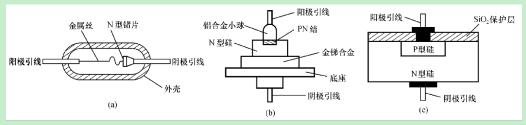


图 5: 二极管常见类型

性质 1.4 (二极管的伏安特性) 下面给出二极管的几个性质

• 二极管与 PN 结伏安特性的异同

。 异

- 二极管导通后认为 U 近似不变 (恒压)
- 二极管具有导通压降7通常硅管取 0.7V, 锗管取 0.2V)
- 同: 都具有死区电压 8(通常硅管取 0.5V, 锗管取 0.1V)
- 二极管的伏安特性曲线如下, 其中 $U_{(BR)}$ 是击穿电压, I_{S} 是反向饱和电流, U_{on} 是死区电压

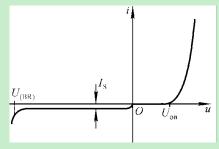


图 6: 二极管伏安特性曲线

- ■温度对二极管伏安特性的影响:当温度升高时,二极管的正向特性曲线向左移(更容易导通),反向特性曲线向下移(少子增多,反向饱和电流变大)
- 二极管的主要参数

⁶工频就是一般的市电 (工业用电) 频率,在我们国家是 50 赫兹。工频是很低的频率。我国通常叫的工频,就是指 50HZ 的交流电。

⁷即达到该电压后二极管彻底导通, 电压不再变化

⁸死区电压,指的是即使加正向电压,也必须达到一定大小才开始导通,这个阈值叫死区电压

- 最大整流电流 I_F: I_F 是二极管长期运行时所允许的最大正向平均电流,若超过 I_F 二极管可能被热击穿。
- 最大反向工作电压 U_R : U_R 是二极管工作时所允许外加的最大反向电压,若超过 U_R 二极管可能因反向击穿而损坏。 U_R 通常取击穿电压 $U_{(RR)}$ 的一半。
- 反向电流 I_R : I_R 是二极管未击穿时的反向电流。 I_R 越小说明二极管的单向导电性越好。 I_R 对温度非常敏感。
- 最大工作频率 fM: 当电流频率超过 fM, 二极管将不能很好的体现单向导电性%

推论 (二极管的等效电路) 二极管的等效电路可以概括为三直一交

- 理想模型: 导通时正向压降为 0, 截止时反向电流为 0。
- 恒压降模型: 只是将理想模型的导通点向右移了一个 Uon。(最常用)
- 折线模型: 在恒压降模型的基础上增加了一个 ro 直流电阻。(科研论文)
- 交流等效模型: 在静态工作点附近加一微变量, 其变化量用静态工作点的导数近似估计。

2 基本放大电路

3 集成运算放大电路

4 放大电路的频率响应

定理 4.1 定理 theorem

引理 4.2 引理 lemma

性质 4.3 性质 proposition

推论 推论 corollary

定义 4.1 定义 definition

猜想 4.1 猜想 conjecture

例 4.1 例 example

评论 评论 remark

注 注 note

案例 2 案例 case

5 放大电路中的反馈

⁹见定义1.7

5.1 反馈

定义 5.1 反馈:将输出量的一部分作用到输入回路,用来影响输入量。 注 反馈又有正负反馈、直交流反馈和本级级间反馈之分,这是显然的。



图 7: 反馈电路示意图

注 判断反馈类型的经验方法:

在输出端采样,一般为电压采样,在输出端上下方采样,一般为电流采样。

反馈点与输入端不同端为串联反馈, 同端为并联反馈。

⊕-⊕10常为串联,⊕+⊝常为并联

这是容易记忆的,只需判断是什么采样,是串联¹¹或者并联反馈,再判断是正负反馈和交直流反馈,就可以组成名词:直流电压并联负反馈。

- 6 信号的运算与处理
- 7 波形的发生和信号的转换
- 8 功率放大电路
- 9 直流电源

¹⁰这里的 ⊕,⊖应理解为前者是输入量,后者是反馈量,⊕是正的,⊖是负的

¹¹以电压方式相叠加, 反之亦然